レーザー三次元造形による石英ガラス回折光学素子の直接創成

公益財団法人レーザー技術総合研究所 レーザー技術開発室
主任研究員・室長 本越 伸二
(平成 27 年度 一般研究開発助成 AF-2015216)

キーワード:レーザー,三次元造形,光学素子

1. 研究の目的と背景

近年,3D プリンティング (Additive Manufacturing) と 称される「三次元造形」技術は大きな注目を集めている. 紫外線硬化材料と紫外線ランプ(レーザー)光を用いて, 照射,積層する三次元造形の研究は,1980年代に既に実 施されている¹⁾.しかし,レーザー光源が高価であった ために広く利用されることはなかった.光源の低価格化, 性能向上に加え,制御ソフトや機構部の進歩により一般 ユーザーでも容易に利用できるようになり,従来の模型 製作から,医療用サンプル,土木・建築部品,さらには 宇宙航空機器にまで応用範囲が広がっている.また,製 造方法も,光造形だけでなく,安価な熱溶解積層や,金 属などの粉末溶融なども行われている.

光学分野において,表面に構造を持つ光学素子,例え ばフレネルレンズや回折格子など,は広く利用されてい る.しかし,これら光学素子の製作は,射出成型やプレ ス法,エッチング加工で行われている.この方法では, 金型やマスクが必要となり,少ロットや試作を行うには 不向きである.そのため,光学分野への三次元造形技術 の適応が期待されている.

Deubel らは、フォトレジスト膜を積層することにより、 三次元構造を持つフォトニッククリスタルの製作を行い、 光学分野への可能性を示した²⁾. Kotz らは、紫外線硬化 樹脂に SiO₂粉体を混ぜた粉体を用いて、紫外線照射によ り三次元構造を造形し、その後 1300℃に加熱することに より樹脂を蒸散しガラス三次元造形を得ている³⁾. Nguyen らは、SiO₂ナノ粒子を含んだシリカゲルインクを 合成し、サブミリメートルのノズル先端より任意のパタ ーンに書き込み、1500℃に熱処理することにより透明ガ ラスを形成している⁴⁾. これらの報告はともにガラスの 三次元造形を可能にするものであるが、最終的に高温熱 処理が必要であり、精密な構造を維持することが困難で ある.

Murahara らは、シリコーンオイルに紫外線ランプを照 射することにより、SiO₂膜を形成することを報告した⁵⁾. 潮解性結晶表面に形成された SiO₂膜は保護膜なり、ほぼ 水を浸透しない高密度に形成されている.しかしながら、 ランプ光であるため、化学反応に時間を要し、また微細 な膜形成には至っていない.ランプ光をレーザー光に替 えることにより、短時間で SiO₂が形成することが可能と なり、微細な構造形成も期待できる. 本研究は,基板上に塗布したシリコーンオイルに紫外 線レーザー光を照射することにより,ガラス三次元構造 を形成することを目的に,その基礎実験を行った.

2. 反応原理

シリコーンオイルの化学構造式は,

$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ [-0 & -Si \\ 0 \\ -Si \\ CH_3 \end{bmatrix} (1)$$

で表される. この Si と C の化学結合を切断し,他の Si またはOと結合することにより,SiO2構造が形成される. Si と C の結合エネルギーは,105kcal/mol であることから, 波長 272nm 以下の紫外光を照射することにより,切断が 可能となる.

本研究で使用したシリコーンオイルの分光吸収特性を 図1に示す. 波長 400nm 以上では吸収がなく透明なオイ ルであることが分かる. 波長 280nm 付近より吸収が現れ, 230nm 以下で急激に吸収係数が増加する. そのため,実 験には波長 230nm 以下の紫外光が有用であることが分 かった.



3. レーザー装置

照射レーザー光源には,波長 193nm の ArF エキシマレ ーザー装置(LAMBDA PHISIK 社 COMPeX100)を用い た(図 2). パルス幅 10ns,繰返しパルス周波数は最大 100Hz まで調整が可能である. パルス最大エネルギーは 75mJ である. 出射ビーム径は 10×25mm² であるため, 試料の大きさに合わせて,ハードアパーチャーにより大 きさを調整した.



図2 ArFエキシマレーザー装置外観

4. 実験方法および結果

4·1 Si02厚膜形成

レーザー光により,短時間で SiO₂厚膜を形成すること を確認した.シリコーンオイルをディップ法により,ス ライドガラス上に数µm 厚で塗布し,レーザーパルスを 7.2mJ/cm²のエネルギー密度でスライドガラス上に照射 した.未照射部,5万パルスと10万パルスを照射した部 分の分光透過率を測定した.測定結果を図3に示す.ス ライドガラスに比べて,シリコーンオイルの屈折率は低 いために,可視域において未照射部の透過率は高い値を 示した.照射パルス数を増加するに従い,可視域の透過 率は減少していることが分かる.これは,レーザー照射 により,SiO₂に変化し屈折率がスライドガラスに近づい たためである.また,特徴的な変化が波長 1200nm,

1400nm, 1700nm 付近に表れている.この波長には水の 吸収が存在する.即ち,レーザー照射パルス数の増加に 従い試料に水分が増加していることを意味する.

式(1) に示したシリコーンオイルの化学構造式より,レ ーザー照射により,Si-C結合が切断されSiO₂構造が形 成されることを示したが,同時にC-H結合も切断され, シリコーンオイル中,または表面大気内の酸素と反応し, 水(H₂O)が生成されたことが分かる.この結果より, ArFレーザーを用いることにより,短時間でSiO₂が形成 されることが確認された.

形成された SiO₂厚膜の厚さを確認するために,スライ ドガラス上にシリコーンオイルを塗布した後,一部をア



ルミフィルムで保護した表面に対してレーザー照射 (7mJ/cm², 10 万パルス)を行い,境界面の段差をレー ザー顕微鏡を用いて計測した.レーザー照射後残留した シリコーンオイルは,有機溶剤を用い除去した.計測し た SiO₂厚膜の様子と段差結果を図4に示す.レーザー照 射された部分は SiO₂となり固化している.またその透過 性はスライドガラス下に置かれた ILT マークの細い線も ボケることなく確認できることから,散乱,歪みの少な



図4 形成された SiO₂ 厚膜の様子(a)と段差計測結果(b)

い厚膜となっていることが分かる. また, 段差計測の結 果,約 200mmの厚さの SiO₂が形成されていることが分 かった.

4・2 球面レンズ形成

約 200mm の SiO₂厚膜の形成が可能であることが確認 されたので、球面レンズの形成を試みた.レーザー装置 から出射したレーザー光を直径 7mm のハードアパーチ ャーにより1部を抜き出し、伝搬後シリコンウェハ上に 塗布したシリコーンオイル上に照射を行った.レーザー 照射中のシリコンウェハの様子を図5に示す.図の中央 部のみ丸くオイル面が変化している部分が確認できる. これはレーザー照射により、SiO₂の形成が始まり屈折率 が変化するためである.エネルギー密度 7mJ/cm²のレー ザーパルスを5万パルス、10万パルス照射した後、残留 シリコーンオイルを除去した表面の様子を図6に示す.5



図 5 シリコンウェハ上シリコーンオイルへ のレーザー照射の様子.写真中央,照 射部分だけ屈折率が変化し始めるため 歪んで見える.



図 6 シリコンウェハ表面に形成された SiO₂ 球面レンズ構造. 左:10万パルス, 右: 5万パルス

万パルス,10万パルス,どちらのパルス数に対しても, 綺麗な球面凸レンズ形状が形成された.レンズ形状が形 成された理由は,①直径7mmに抜き出したビームの強 度分布,②ハードアパーチャーを通過したことによる回 折の影響,が考えられる.またレーザーパターンでは極 端な強度分布は確認できなかったことから,照射時の温 度分布も反応に寄与したものと考えられる.

干渉計および計測レーザー光により焦点距離(レンズ 曲率)の評価を試みたが,正確な数値を求めることがで きなかった.先の実験より,200µmの厚膜が形成されて いることから,凸面の中心厚さを200µmと見積もること ができ,直径7mmによる曲率半径は30.7mmとなり,屈 折率1.46の媒質による焦点距離は約33mmが期待できる ことになる.直径7mmに対して焦点距離33mmは,精 度のよい測定光学系が必要である.

4・3 回折格子の形成

レーザー光の強度分布に応じて,SiO2厚膜が形成され ることから,二光束干渉による格子構造の形成を試みた. 実験の概略図を図7に示す.目標とする回折格子構造は, 比較を可能にするために,600本/mmとした.波長193nm に対して,干渉縞の間隔を1.7µm(600本/mmの逆数) にするためには,2本のレーザー光が開き角13.3°で基 板上に照射される必要がある.そのため,分割する2枚 のミラー間隔を50mm,ミラーから基板表面までの距離 を216mmに調整し,それぞれのビームが基板上で重な るように配置した.シリコンウェハ上に塗布したシリコ ーンオイルに,10万パルス照射後,形成されたSiO2厚 膜を観察したが,格子構造は確認できなかった.レーザ 一照射条件を変更し同様の試験を行ったが,格子構造形



図7 二光束干渉による格子構造形成実験配置

成には至らなかった.その原因は、レーザー光のビーム 品質によるものと考えられる.エキシマレーザー装置は マルチモードと称され、複数の発振(モード)光が合成 し得られている.そのため、可干渉性が低くなり、2 ビ ームが重なった基板表面上で干渉縞が形成されなかった と考えられる.

5. 三次元造形による光学素子形成の可能性

シリコーンオイルにArFエキシマレーザー光を照射することにより、SiO₂厚膜が短時間で生成可能であることが確認された.

シリコーンオイルの塗布する厚さや、レーザーパルス エネルギーの最適化を行うことにより、微細構造で積層 する三次元造形は可能であると考えられる.

しかしながら,現状のエキシマレーザーのビーム品質 では,可干渉性が低く,微小サイズに集光照射すること が困難であることも確認できた.実用化素子開発へは, 光源開発も重要な課題と言える.

6. まとめ

本研究では、レーザー三次元造形法を用いて、ガラス 回折光学素子の形成を目的として、基礎実験を行った. シリコーンオイルを溶媒に用いることにより、熱処理も なく SiO₂厚膜が容易に形成でき、ガラス光学素子製造が 可能である結果を得た.一方、微細な加工精度が必要と なる回折光学素子に対しては、照射するレーザー光源の 改善など、重要な課題も明らかになった. 今後,基礎データ取得を更に積み重ねるとともに,光 源の開発も行うことにより,任意の構造を持つ三次元光 学素子の創成が期待できる.

謝辞

本研究遂行に際して,公益財団法人天田財団より研究 助成(一般研究開発助成 AF-2015216)を頂いた.ここに 謝意を表する.

参考文献

1) 中井孝・丸谷洋二:レーザー研究, 16 (1987) 14.

- M.Deubel, G.V.Freymann, M.Wegener, S.Pereira, K.Busch, C.Soukoulis: Nature Materials 3 (2004) 444.
- F.Kotz, K.Arnold, W.Bauer, D.Schild, N.Keller, K.Sachsenheimer, T.M.Nargang, C.Richter, D.Helmer, B.E.Rapp: Nature 544 (2017) 337.
- D.T.Nguyen, C.Meyers, T.D.Yee, N.A.Dudukovic, J.F.Destino, C.Zhu, E.B.Duoss, T.F.Baumann, T.Suratwala, J.E.Smay, R.D.-Sperars: Adv. Mater. 29 (2017) 1701181.
- M.Murahara, T.Funatsu, Y.Okamoto: Proc. of SPIE 5647 (2005) 224.